## CMOS Digital VLSI Design

Prof. Habil. Dr. Ing. Decebal Popescu

Modulul 2

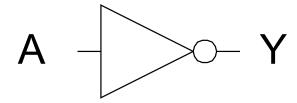
**Inversorul CMOS** 

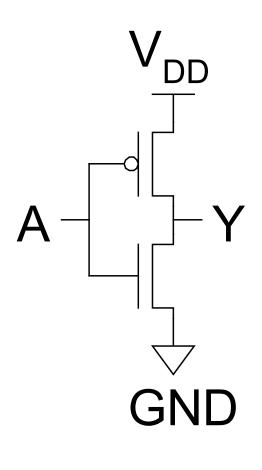
#### **Inversorul CMOS**

- Ideea de bază a unui inversor CMOS
- Modelul de tip switch al unui inversor
- Comportament static
- Caracteristicile de transfer ale tensiunii  $V_{Tc}$  în cazul în care variez tensiunea de intrare ( $V_{in}$ ) de la 0V la 5V cum se va comporta tensiunea de ieșire ( $V_{out}$ )
- Comutarea switching threshold acea tensiune la care tranziția din 0 în 1 sau din 1 în 0 are loc
- Zgomot orice semnal introdus în price circuit are un zgomot, de aceea în prima fază dorim să rejectăm acest zgomot
- Calculul câștigului =  $\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$

#### **Inversorul CMOS**

Α	Υ
0	
1	

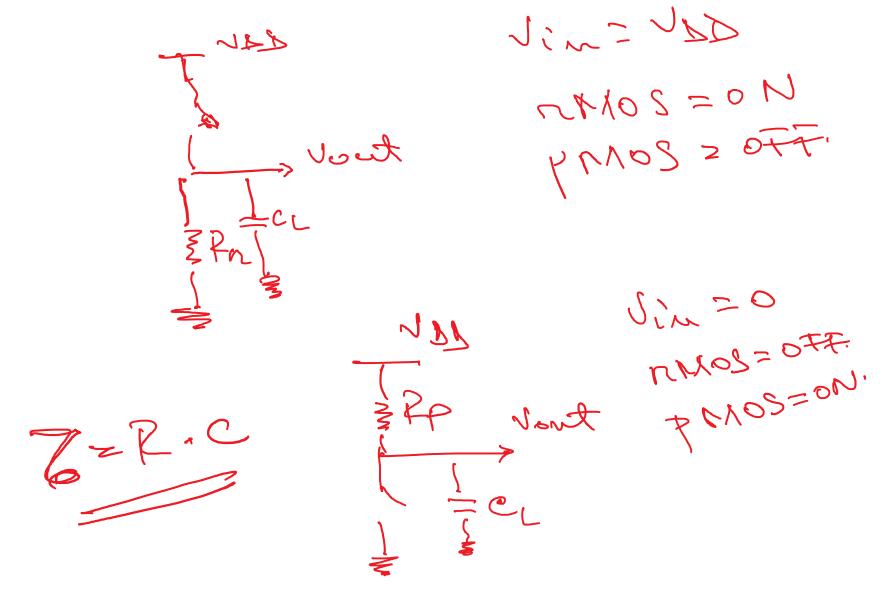




MOSZOFF. prussiu mad saturat.

( JG = 1/1H) 1 MOS 20PF MMOS 20N uppos functioneagé ân modul Saturat PMOS functiones E ch anto ff.

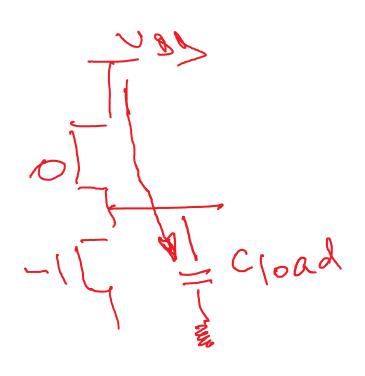
### Inversorul ca un comutator – switch model



### Operarea în modul static

Mod static det. & Switch din o du 1 san din 1 1) Na se consuma partere D'ale directa intre UDB & GND 2). Z imbruatateste fanout -Do-France 1 = 4. Steady state. 3). Impedanté micé le jestre farsnigeaté atennares 2 gomotului

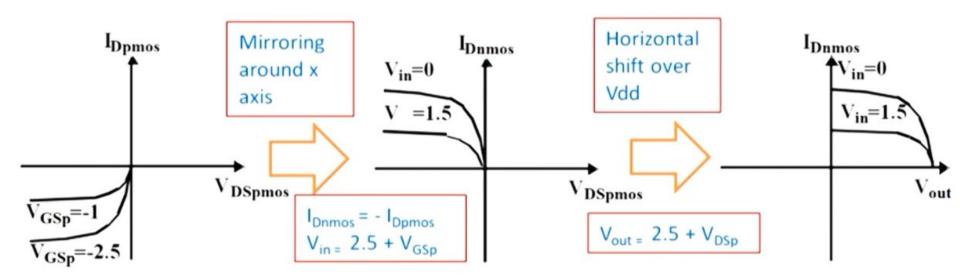
### Operarea în modul static



- M1 se mai numește și dispozitiv pull down – PDD – 1 în 0
- M2 se mai numește și dispozitiv pull up (PUD) – 0 în 1
- Tot ce este deasupra lui  $V_{out}$  este PUD
- Tot ce este sub  $V_{out}$  este PDD

#### Cracteristicile de transfer pentru tensiune - $V_{TC}$

$$Vdd = 2.5$$



Source: prof. Sudeb Dasgupta course

$$I_{DSp} = -I_{DSn}$$
 -» (+ pentru că avem electroni și – pentru că avem găuri)

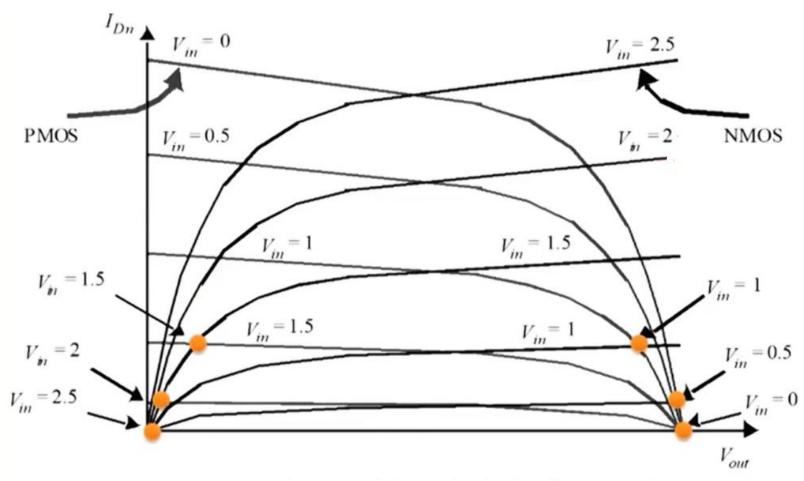
$$V_{GSn} = V_{in}$$

$$V_{GSp} = V_{in} - V_{DD}$$

$$V_{DSn} = V_{out}$$

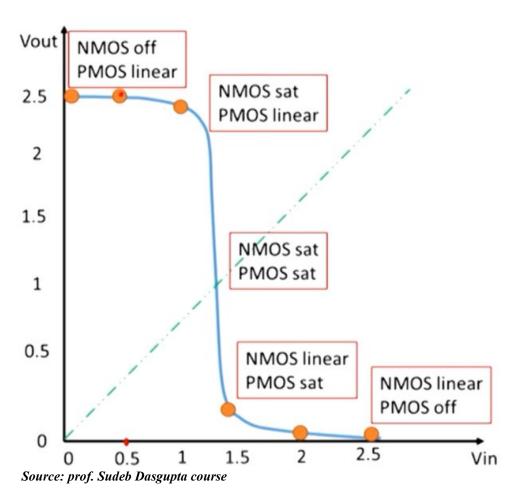
$$V_{DSp} = V_{out} - V_{DD}$$

#### Cracteristicile de transfer pentru tensiune - $V_{TC}$



Source: Digital Integrated Circuits (2nd Edition)- Jan M. Rabaey

#### Cracteristicile de transfer pentru tensiune - $V_{TC}$



#### Pragul de comutare

• Din figura anterioară avem că tranzistorul nMOS este în modul saturat ca și tranzistorul pMOS deci  $I_{DSn}=-I_{DSp}$  adică  $I_{DSn}+I_{DSp}=0$  ceea ce conduce la următoarea exprimare

$$k_n V_{DSATn} \left( V_M - V_{Tn} - \frac{V_{DSATn}}{2} \right) + k_p V_{DSATp} \left( V_M - V_{DD} - V_{Tp} - \frac{V_{DSATp}}{2} \right) = 0$$

unde

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

de unde rezultă  $V_M$ 

$$V_M = \frac{\left( v_{Tn} + \frac{v_{DSATn}}{2} \right) + r\left( v_{DD} + v_{Tp} + \frac{v_{DSATp}}{2} \right)}{1 + r} \text{ unde } r = \frac{k_p v_{DSATp}}{k_n v_{DSATn}}$$

Presupunând că  $V_{DSATp} = V_{DSATn}$  atunci r se va deveni  $r = \frac{\mu_p W_p}{\mu_n W_n}$ 

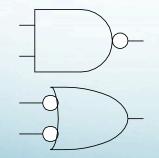
#### Pragul de comutare

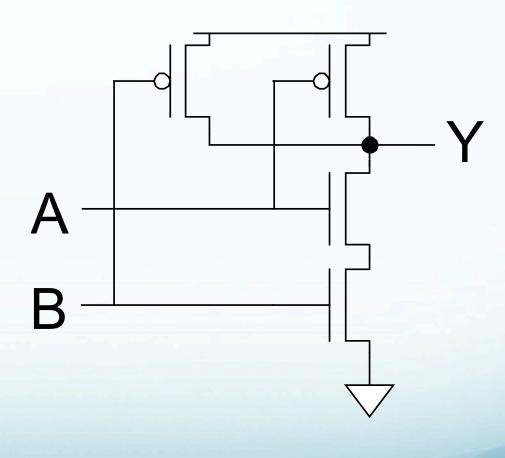
• Dacă presupun că r=1 iar  $V_{tn}=V_{tp}$  și  $V_{DSATn}=-V_{DSATp}$  atunci  $V_m=rac{V_{DD}}{2}$ 

• Totodată 
$$\frac{\mu_p W_p}{\mu_n W_n} = 1 \ \Rightarrow \frac{\mu_p}{\mu_n} = \frac{W_n}{W_p}$$

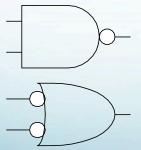
• Având în vedere faptul că mobilitatea electronilor este de 3 ori mai mare decât mobilitatea găurilor, deci raportul de  $\frac{1}{3}$  va trebui menținut și în partea dreaptă a egalității ceea ce conduce la faptul că  $W_p$  este mai mare decât  $W_2$  de cel puțin 3 ori.

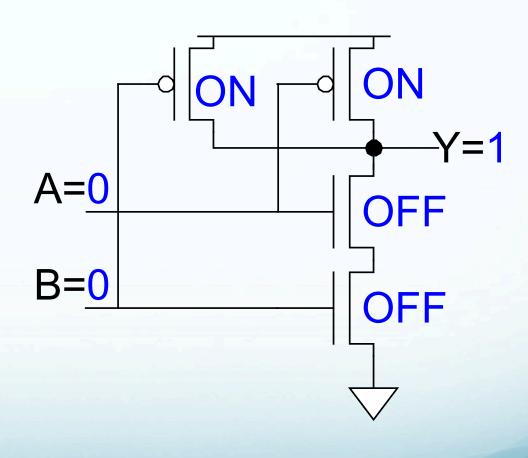
Α	В	Υ
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



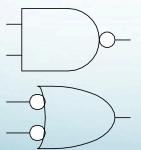


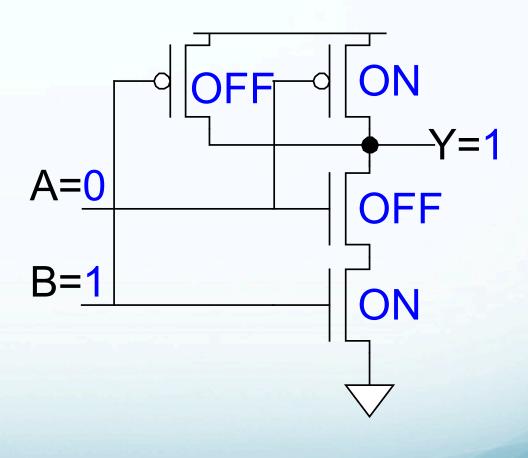
Α	В	Y
0	0	1
0	1	
1	0	
1	1	
		)o_



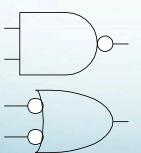


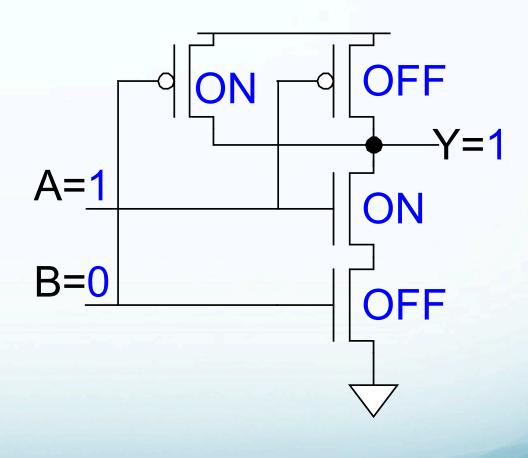
0	0	4
	O	1
0	1	1
1	0	
1	1	



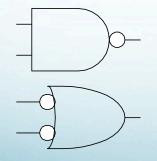


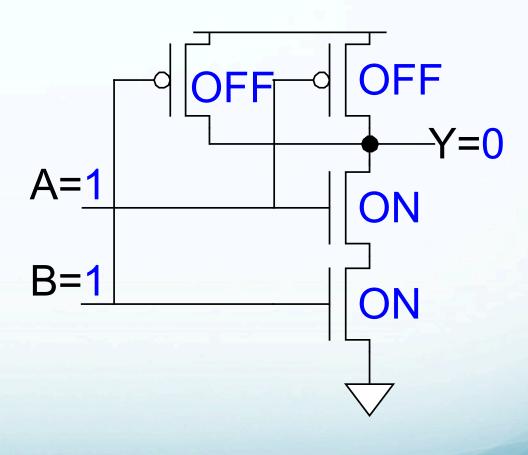
Α	В	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	





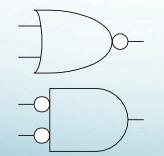
Α	В	Υ
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

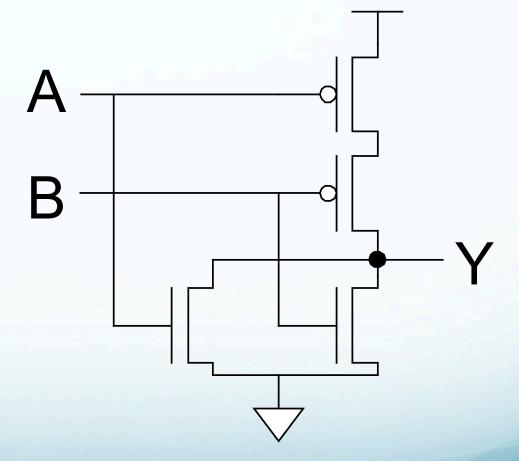




## Poarta CMOS NOR

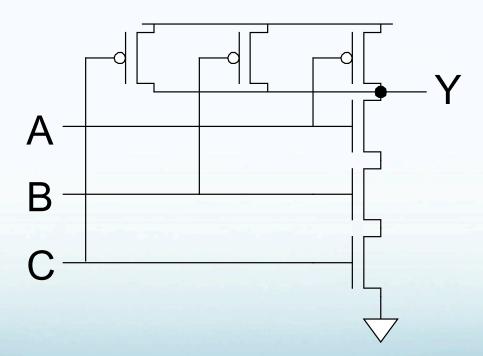
Α	В	Υ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0





# 3-input NAND Gate

- Y = 0 dacă toate intrările sunt 1
- Y = 1 dacă toate intrările sunt 0

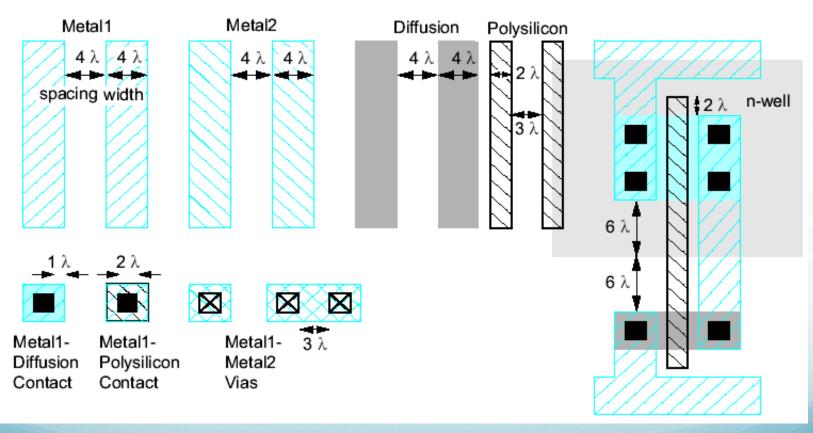


# Layout

- Chip-urile sunt specificate printr-un set de măști
- Dimensiunea minimă a măstilor determină mărimea tranzistorului (deci viteza, costul, și puterea)
- Dimensiunea trăsăturii f = distanța dintre drenă și sursă
  - Setată de lățimea minimă a polysilicon
- Dimensiunea trsăturii crește cu 30% la fiecare 3 ani
- Normalizarea dimensiunii trăsăturii când descriem regulile proiectării
- Regulile se exprimă în termeni de  $\lambda = f/2$ 
  - a.î.  $\lambda = 0.3 \, \mu \text{m} 0.6 \, \mu \text{m}$  intr-un proces

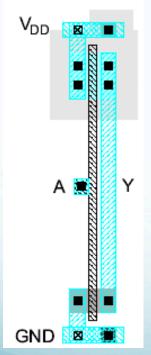
# Reguli de proiectare

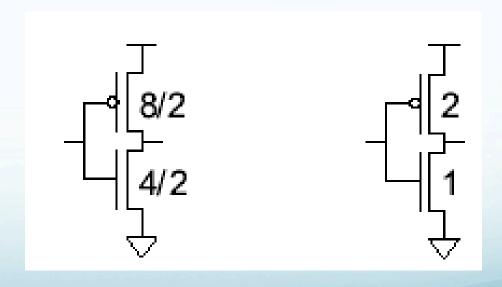
Reguli de proiectare elementare



### Inversorul

- Dimensiunile tranzistorului sunt specificate ca Lăţime/Lungime
  - Dimensiunea minimă  $4\lambda$  /  $2\lambda$ , uneori denumită unitatea 1
  - Pentru un proces de 0.6 μm, W=1.2 μm, L=0.6 μm





### Sumar 1

- Tranzistoarele MOS sunt o stivă de porți, oxid, silicon
- Pot fi vizualizate ca switch-uri controlate electric
- Construim porți logice din switch-uri
- Desenăm măștile layout-ului specific din tranzistori